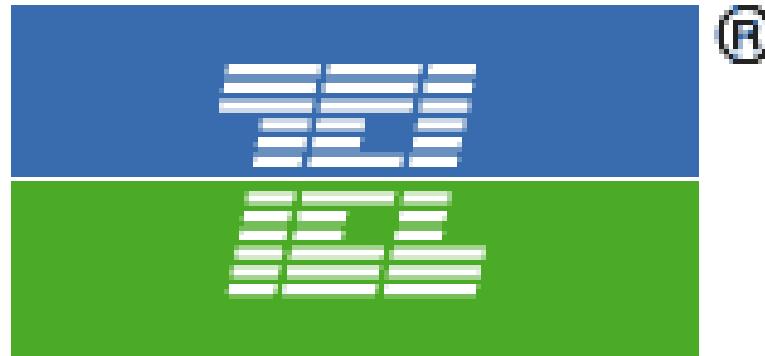


# 第44期定時株主総会



東京エレクトロン株式会社  
2007年6月22日



# 報告事項

- 第44期の成果報告
- 事業環境の変化と今後の経営方針

# 第44期の成果報告

代表取締役社長 佐藤 潔



# 報告内容

第44期の成果報告

重点施策とその成果

今後の成長戦略



# 第44期の成果報告



# 第44期 連結業績ハイライト

## 損益計算書

過去最高の売上・利益達成

## 貸借対照表

財務体質のさらなる改善

## キャッシュフロー計算書

継続的キャッシュフローの創出

## 配当金

業績連動型配当の継続的実施



## 第44期 連結業績ハイライト

過去最高の売上・利益達成

売上高 26.5%、営業利益90.2%増加(対前期比)

財務体質のさらなる改善

有利子負債・自己資本比率が17.3%から8.7%に改善

純資産が前年比 929億円増加

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュフロー 542億円を創出

フリーキャッシュフロー 290億円のプラス

業績連動型配当の継続実施

1株当たり年間配当金 103円

## 連結損益計算書

(単位:億円)

	連結			増減率
	第43期 (%)	第44期 (%)		
売上高	6,736 100.0	8,519 100.0		26.5%
営業利益	757 11.2	1,439 16.9		90.2%
経常利益	759 11.3	1,439 16.9		89.5%
当期純利益	480 7.1	912 10.7		90.1%



## 第44期 連結業績ハイライト

過去最高の売上・利益達成

売上高 26.5%、営業利益90.2%増加(対前期比)

財務体質のさらなる改善

有利子負債・自己資本比率が17.3%から8.7%に改善

純資産が前年比 929億円増加

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュフロー 542億円を創出

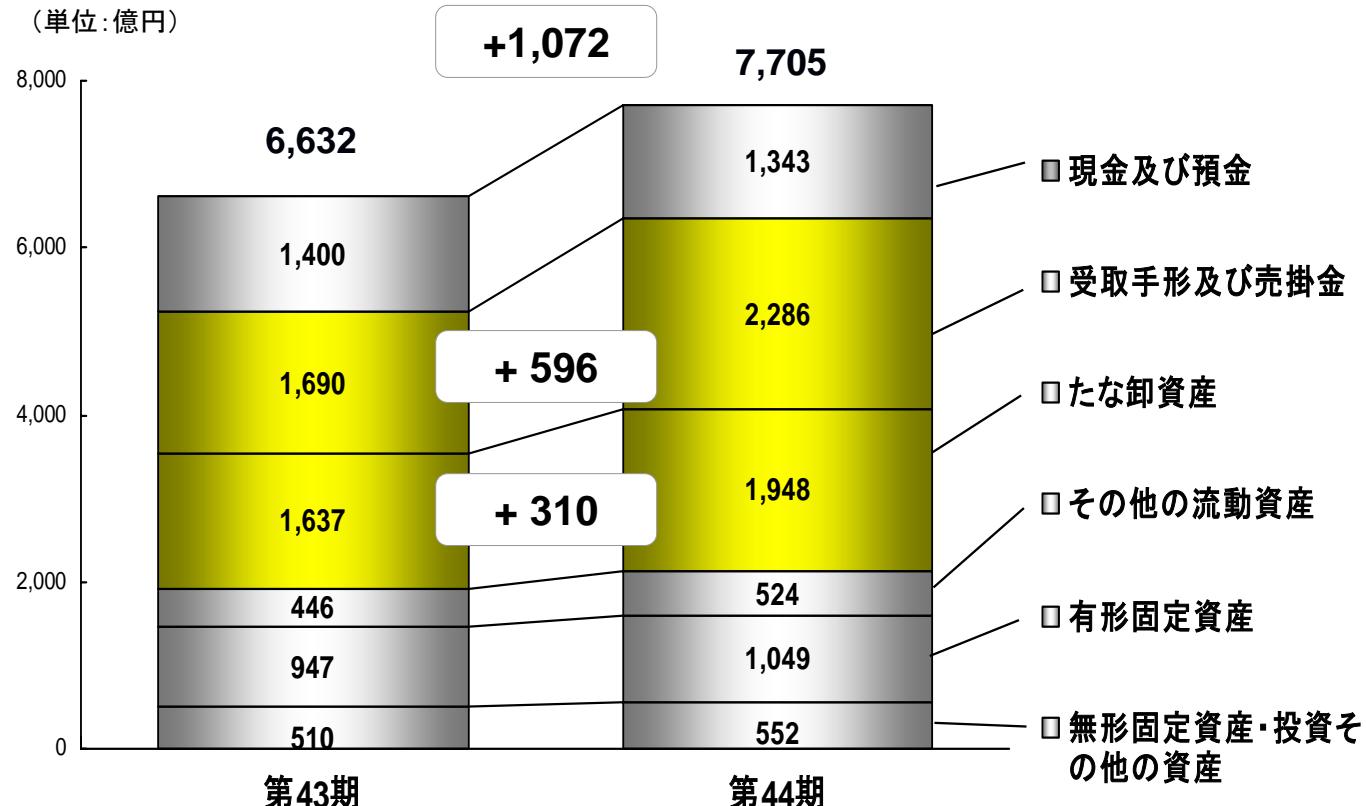
フリーキャッシュフロー 290億円のプラス

業績連動型配当の継続実施

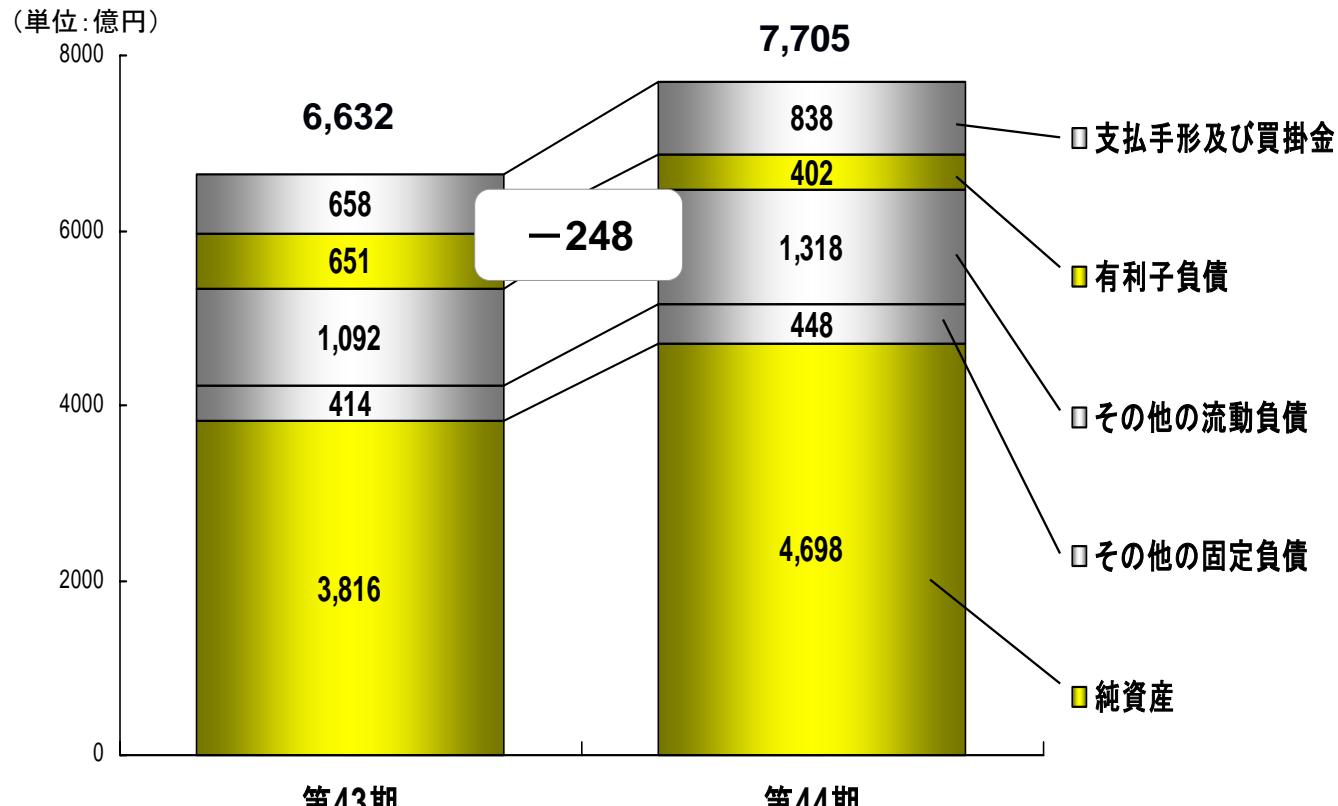
1株当たり年間配当金 103円



## 連結貸借対照表（資産）



## 連結貸借対照表（負債・純資産）



有利子負債・自己資本比率が17.3%から8.7%に改善



## 連結株主資本等変動計算書

(単位:億円)

	株主資本				評価・換算差額等、 新株予約権、 少数株主持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式		
前期末残高(第43期)	549	780	2,499	151	147	3,826
当期変動額						
剰余金の配当			128			128
役員賞与			3			3
当期純利益			912			912
自己株式の取得・処分		2		29		32
株主資本以外の変動額					58	58
当期変動額合計	-	2	780	29	58	871
当期末残高(第44期)	549	783	3,280	121	206	4,698

(注)前期末の純資産合計は新株予約権と少数株主持分を含んだものとしております。



## 第44期 連結業績ハイライト

### 過去最高の売上・利益達成

売上高 26.5%、営業利益90.2%増加(対前期比)

### 財務体質のさらなる改善

有利子負・自己資本比率が17.3%から8.7%に改善  
純資産が前年比 929億円増加

### 継続的キャッシュの創出

営業キャッシュフロー 542億円を創出  
フリーキャッシュフロー 290億円のプラス

### 業績連動型配当の継続実施

1株当たり年間配当金 103円



## 連結キャッシュ・フロー(CF)計算書

(単位:億円)

	第43期	第44期	増減
期首現金残高	1,154	1,400	246
営業活動によるCF	788	542	△ 245
投資活動によるCF	△ 105	△ 252	△ 147
財務活動によるCF	△ 434	△ 347	87
期末現金残高	1,400	1,343	△ 56

# 単独 損益計算書・貸借対照表

(単位:億円)

損益計算書		
科目	金額	(%)
売上高	7,201	100.0
営業利益	710	9.9
経常利益	766	10.6
当期純利益	516	7.2

貸借対照表			
科目	金額	科目	金額
現預金	1,155	買掛金	1,101
受取手形/売掛金	2,018	一年以内 償還予定社債	55
たな卸資産	783	その他の流動負債	1,044
その他の流動資産	1,008	社債	300
有形固定資産	314	その他の固定負債	171
無形固定資産 投資その他の資産	668	純資産合計	3,277
資産合計	5,949	負債純資産合計	5,949

## 単独株主資本等変動計算書

(単位:億円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式及び評価・換算差額他	純資産合計
前期末残高(第43期)	549	780	1,632	99	2,863
当期変動額					
特別償却準備金の積立・取崩*1					-
別途積立金の積立*2					-
剰余金の配当*3				128	128
役員賞与*2				2	2
当期純利益				516	516
自己株式の取得・処分他			2	24	27
当期変動額合計	-	2	386	24	413
当期末残高(第44期)	549	783	2,018	74	3,277

\*1 第43期利益処分、ならびに第44期決算の合計となります。

\*2 第43期利益処分によるものです。

\*3 第43期利益処分、ならびに第44期中間配当の合計となります。



## 第44期 連結業績ハイライト

過去最高の売上・利益達成

売上高 26.5%、営業利益90.2%増加(対前期比)

財務体質のさらなる改善

有利子負債株主資本比率が17.3%から8.7%に改善

株主資本が前年比 929億円増加

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュフロー 542億円を創出

フリーキャッシュフロー 290億円のプラス

業績連動型配当の継続実施

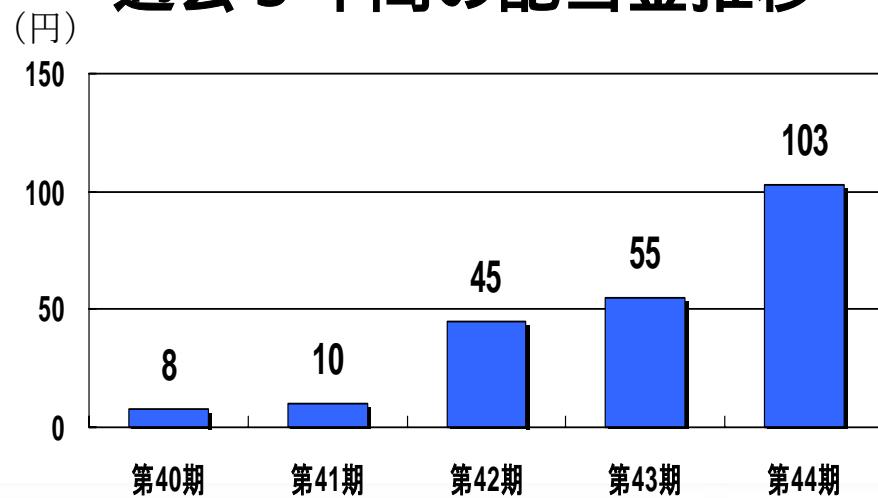
1株当たり年間配当金 103円

# 剰余金の配当

## 1株当たり配当金

	中間	期末	年間	配当総額	連結 配当性向
第44期	42 円	61 円	103 円	184 億円	20.1 %

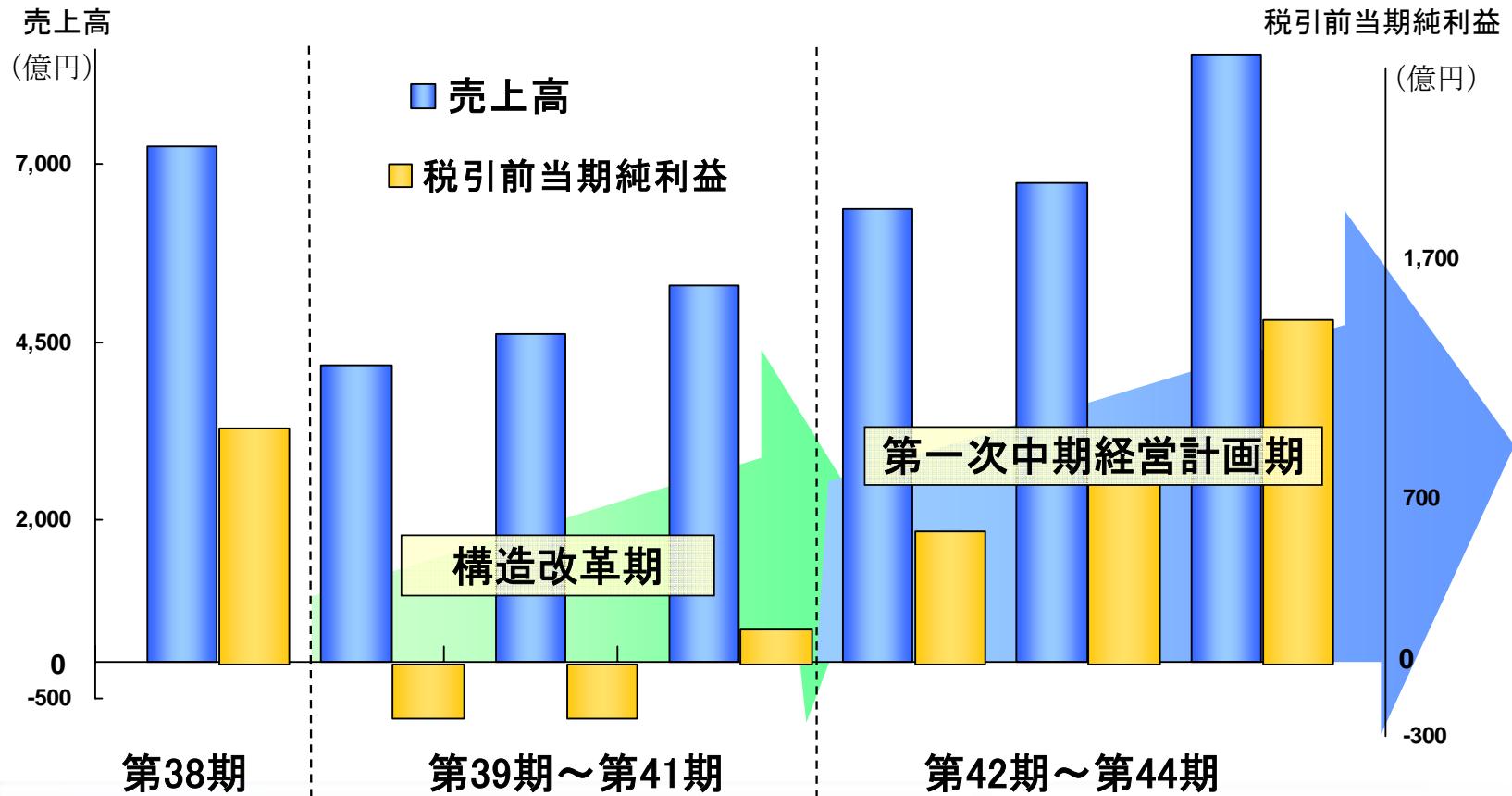
## 過去 5 年間の配当金推移



# 第44期までの 重点施策とその成果



## 第44期までの重点施策



## 第42期～第44期の重点施策 第一次中期経営計画

過去最高の売上・利益を達成

営業利益率 10%回復

### 第一次中期経営計画期

- 新製品創出の強化
- モノ作りの強化
- 経営効率の改善

### 構造改革期

- 固定費の削減
- 在庫の適正化

第39期～第41期

第42期～第44期

さらなる成長期へ

第45期～



# 第42期～第44期の重点施策 第一次中期経営計画

## ＜経営目標＞

既存事業の拡大、収益力の向上

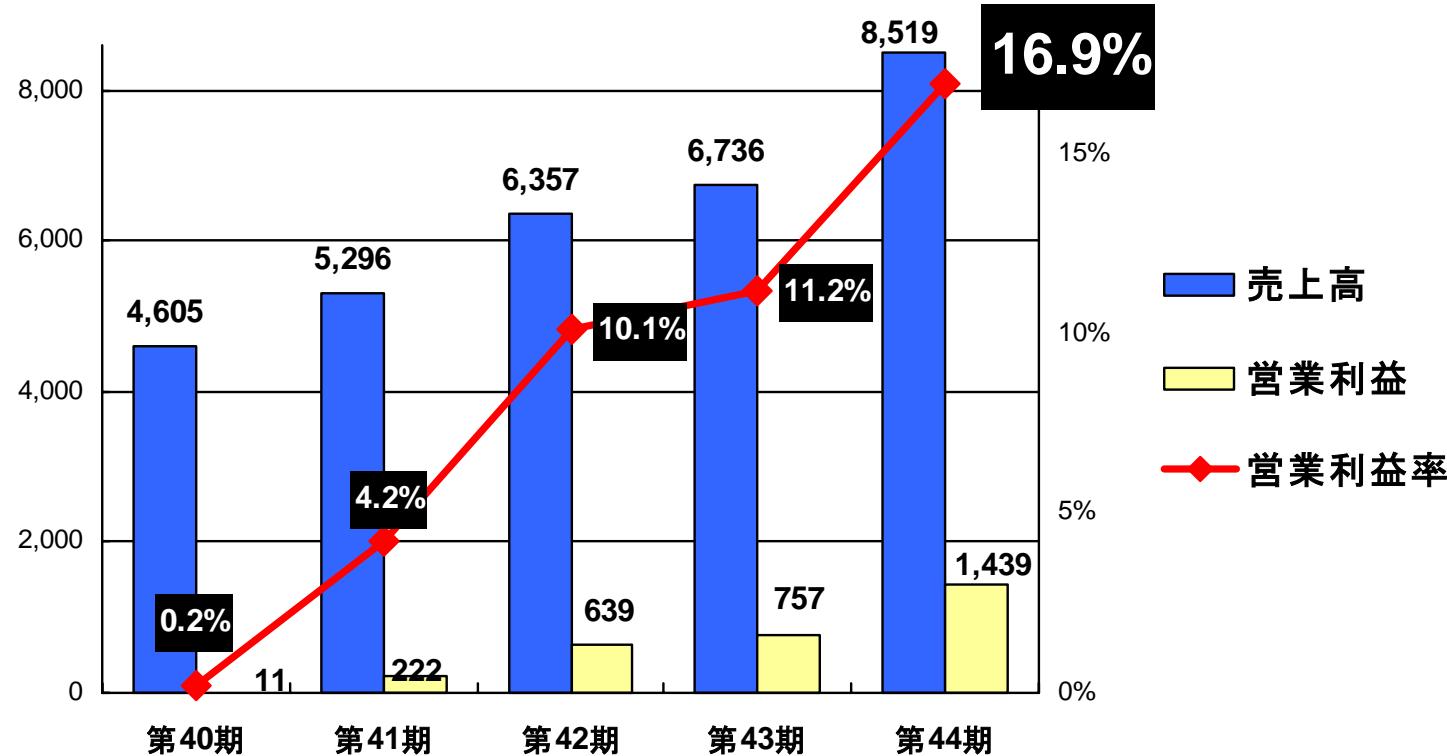
重点施策	主な成果
新製品の創出と強化	主要新製品 第42期：4機種 ⇒ 第44期：8機種
モノ作りの強化	製造期間・据付期間を30%短縮 (当社製品の一例)
経営効率の改善	従業員一人当たりの連結営業利益 第42期：700万円 ⇒ 第44期：1,500万円



# 重点施策の成果 1

## 売上高・営業利益率の推移

(単位:億円)



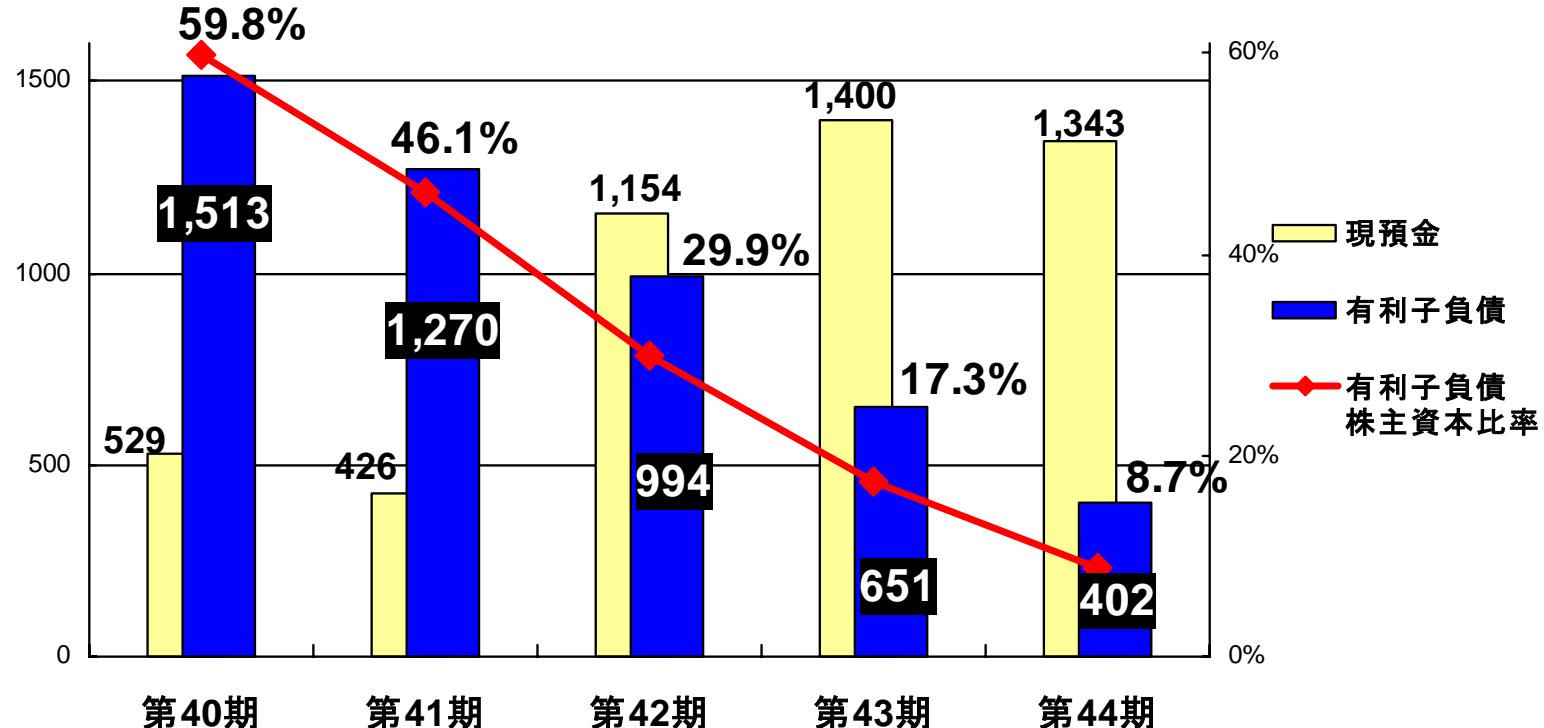
過去最高の売上と利益を達成



## 重点施策の成果 2

# 有利子負債・現預金の推移

(単位:億円)



強固な財務基盤の確立

有利子負債株主資本比率 = 有利子負債 ÷ 株主資本



# 今後の成長戦略



## さらなる成長のための取り組み

技術開発強化  
による

新製品の創出と拡販

高効率生産  
による

コスト競争力の強化

新規事業創出  
による

規模の成長

施策 **■** 投入した新製品の  
量産及び拡販

**■** 競争力の高い  
工場の建設  
**■** 最大生産効率  
の追求

**■** 新規事業育成  
及び事業化の  
強力推進

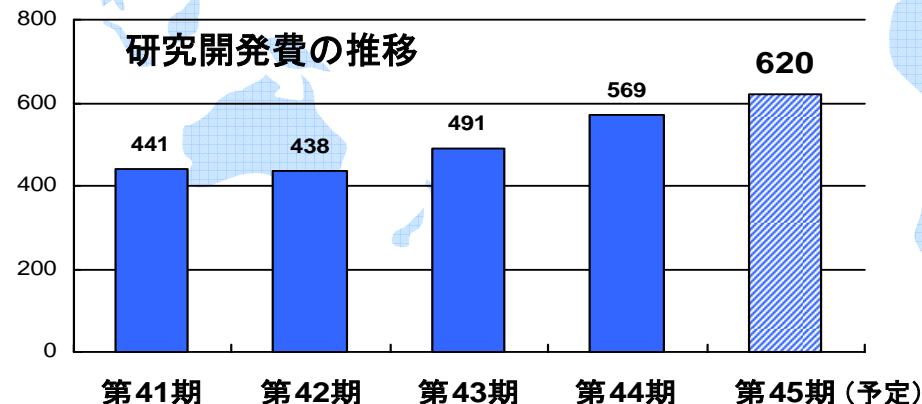
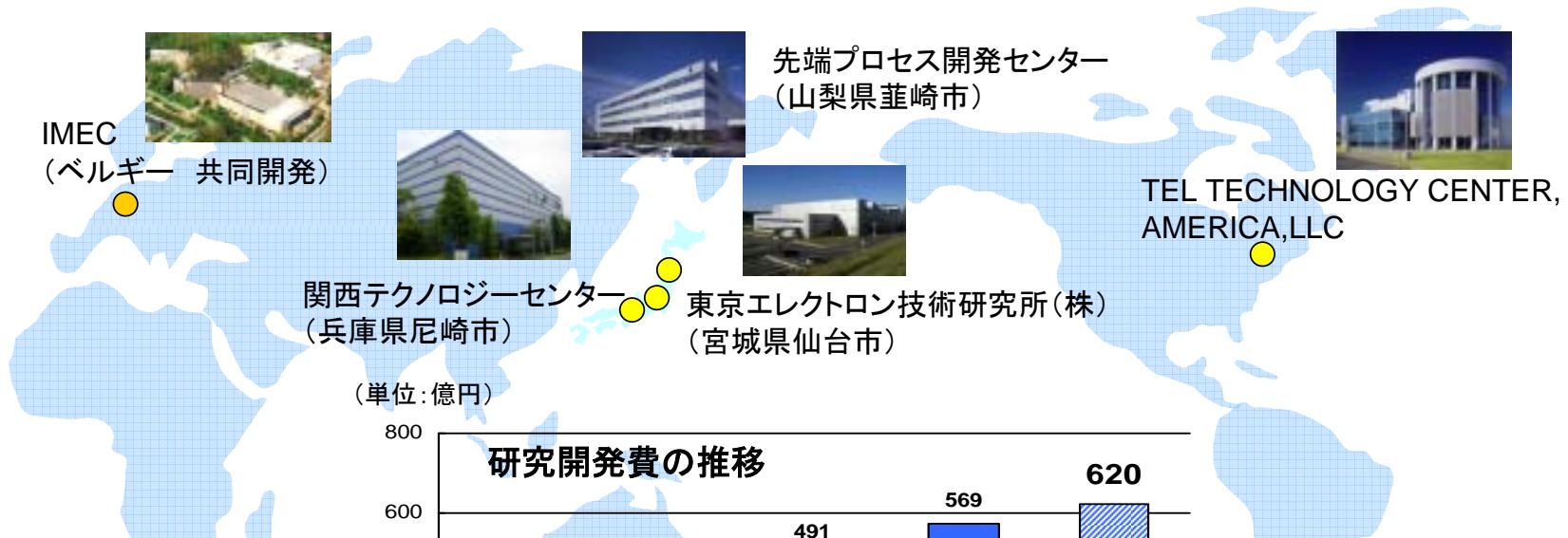
担当 **■** 開発部門  
**■** 営業部門

**■** 製造部門

**■** マーケティング部門  
**■** 開発部門



# 今後の成長戦略 1 技術開発の強化



さらに多くの新製品を創出していきます



# 今後の成長戦略 1

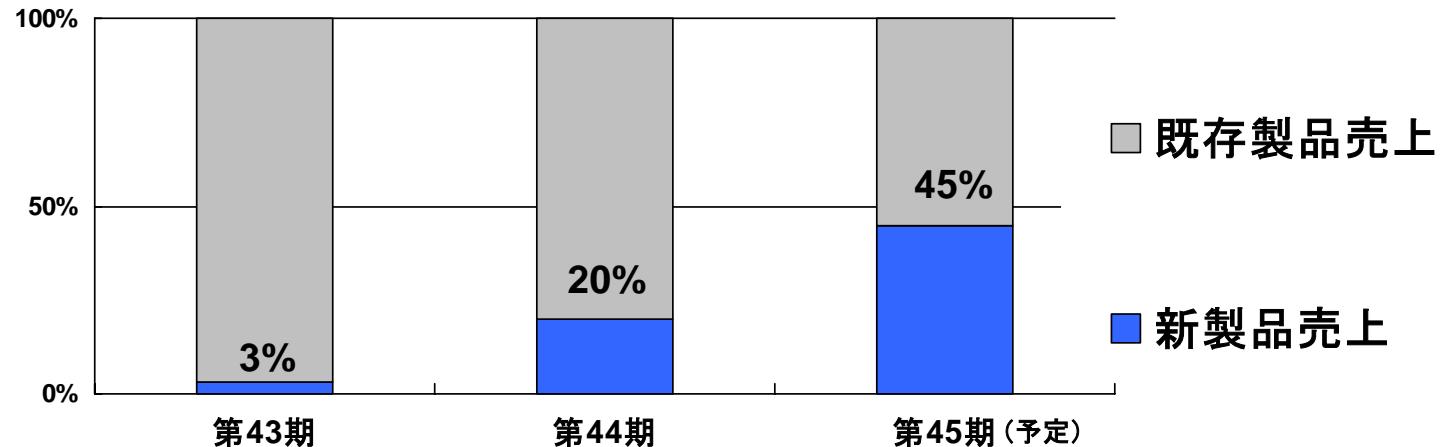
## 投入した新製品の拡販

CLEAN TRACK™  
LITHIUS Pro™Tactras™  
Vigus™

EXPEDIUS™+



Precio™

TELINDY™  
IRad™

### 世界的な販売網で拡販していきます

※新製品は過去2年間にリリースした製品で計算しております。



# 高効率生産によるコスト競争力の強化

## 最大生産効率の追求

- 1.品質の向上
- 2.製造工期の短縮
- 3.製造コストの低減



- ・設計段階からのコストダウン
- ・場内生産の強化
- ・外注請負比率の適正化

熊本第三工場棟  
(2007年6月竣工)



## 競争力の高い理想の工場建設

- 1.開発と製造を集約した一貫体制
- 2.产学連携による最新技術や技術者の確保
- 3.先進の環境対応工場



宮城新工場

立地: 宮城県黒川郡大和町  
面積: 300,000 m<sup>2</sup>  
計画: 2010年4月竣工予定

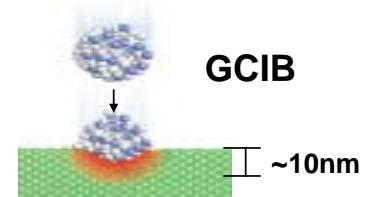


# 今後の成長戦略 3 新規事業育成および事業化の強力推進

## ■ 半導体製造装置の新規分野への参入

2006年12月、米国エピオン社を買収

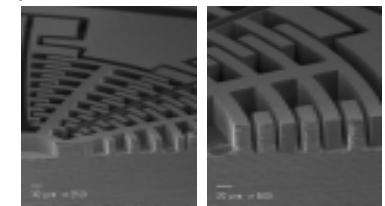
[事業分野] 不純物導入工程、表面改質工程



## ■ 既存事業領域以外の新規分野での事業の育成

2007年6月、MEMS本部を新設

[事業分野] MEMS向け製造装置及び電子部品

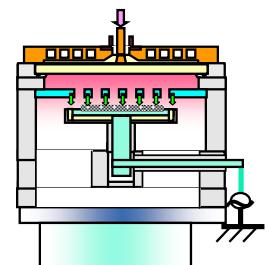


## ■ 新プラズマ技術(RLSA)の事業化の推進

2007年6月、東京エレクトロン技術研究所(株)の設立、

RLSA本部を新設

[事業分野] 成膜工程、エッチャリング工程



RLSA: Radial Line Slot Antenna (低電子温度を特徴とする新プラズマ源)

MEMS: Micro Electro Mechanical Systems (半導体プロセスで作る微小電子機械システム)

GCIB: Gas Cluster Ion Beam (低エネルギーガスクラスターイオンビーム)



# 今後の成長戦略 3 画期的な新プラズマ技術(RLSA)

第44期定時株主総会

パソコンのスピードを5倍、半導体消費電力を1/10  
とする半導体製造技術の開発

1. 同じコンセプト(設計思想)でエッティング工程、CVD工程の装置実現
2. 同一装置で複数工程対応可能、半導体製造工程の大幅削減
3. プラズマのダメージがなく、半導体デバイスの高良品率及び高性能化の実現
4. 高速化・低消費電力化のための新材料成膜・エッティングが可能

対象領域装置の市場規模合計 6,000億円

世界のデジタル機器を一新する技術

CVD: Chemical Vapor Deposition(化学的気相成膜)



## さらなる成長を目指した経営

### 1. 事業のさらなる成長

→ お客様に付加価値の高い製品を提供

### 2. よき企業風土・文化を育てさらなる飛躍へ

→ 夢と活力のある会社・社会的責任を全うする会社

### 3. 事業の成長を通じて企業価値の向上を実現

→ 株主様に満足の提供





私たちの技術が  
世界を支え、未来を創ります。

# 事業環境の変化と 今後の経営方針

代表取締役会長 東 哲郎



# 報告内容

第44期業績実績と第45期業績予想

事業環境の変化

今後の経営方針



## 第44期業績実績と第45期業績予想



## 第44期連結業績実績

(単位:億円)

	連 結			増減率
	第43期 (%)	第44期 (%)		
売上高	6,736 100.0	8,519 100.0		26.5%
営業利益	757 11.2	1,439 16.9		90.2%
経常利益	759 11.3	1,439 16.9		89.5%
当期純利益	480 7.1	912 10.7		90.1%



# 第45期連結業績予想

(単位:億円)

	第45期 (予想)					対前年 増減
	上期 (%)	下期 (%)		通期 (%)		
売上高	<b>4,450</b> 100.0	<b>4,550</b> 100.0		<b>9,000</b> 100.0		+5.6%
営業利益	<b>770</b> 17.3	<b>830</b> 18.2		<b>1,600</b> 17.8		+11.1%
経常利益	<b>790</b> 17.8	<b>850</b> 18.7		<b>1,640</b> 18.2		+13.9%
当期純利益	<b>500</b> 11.2	<b>540</b> 11.9		<b>1,040</b> 11.6		+14.0%

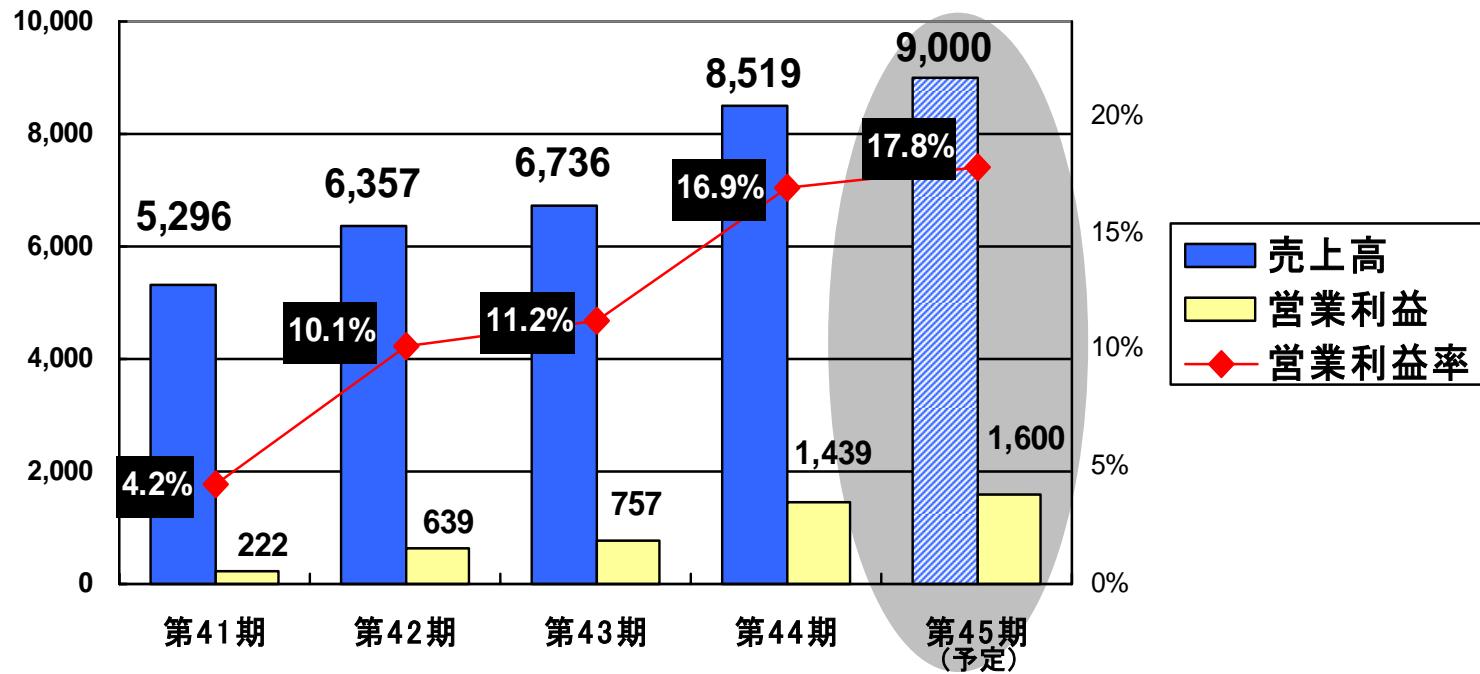


# 第45期業績予想

## 売上高・営業利益率

### 収益性の改善が顕著に

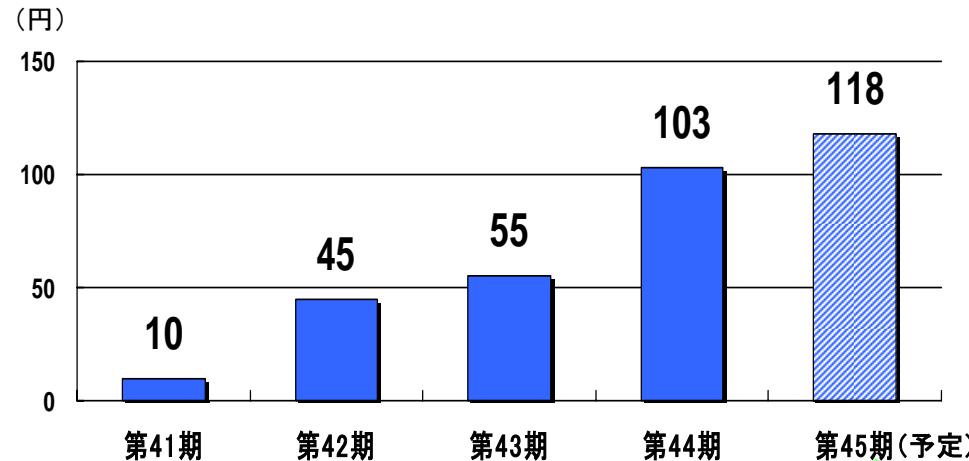
(単位: 億円)



# 第45期配当予想

## 5期連続増配へ

	中間	期末	年間
1株当たり配当予想	57円	61円	118円



2006年3月期より  
連結配当性向 20%

\* 配当性向: 当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかをあらわす比率



# 事業環境の変化



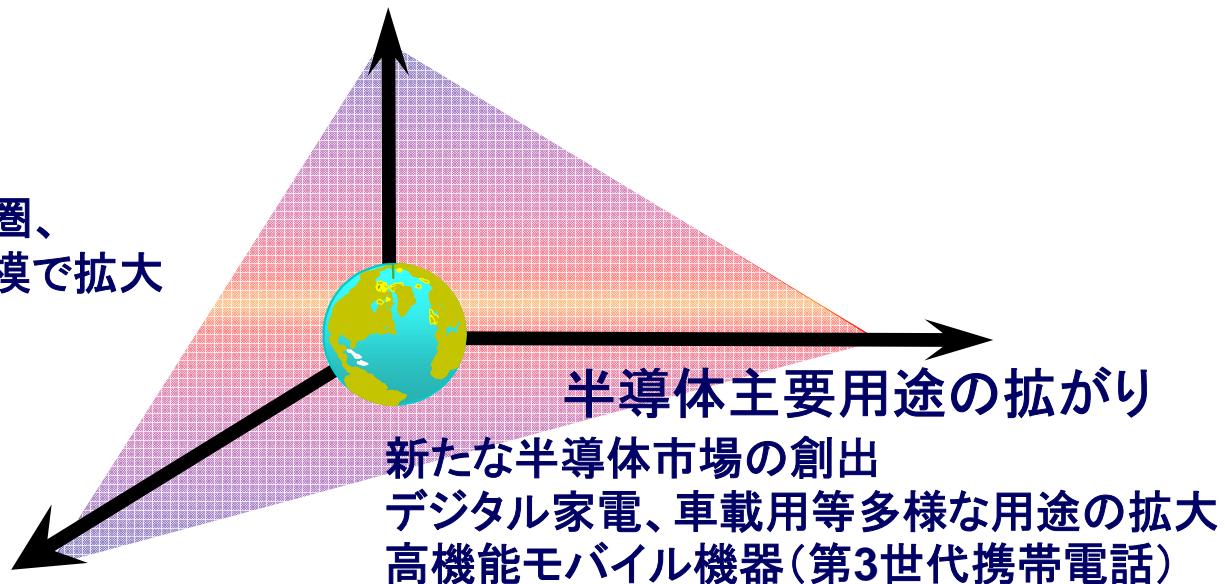
# 事業環境の変化

## 半導体市場に新たな成長の波が起きている

### 半導体使用量の伸び

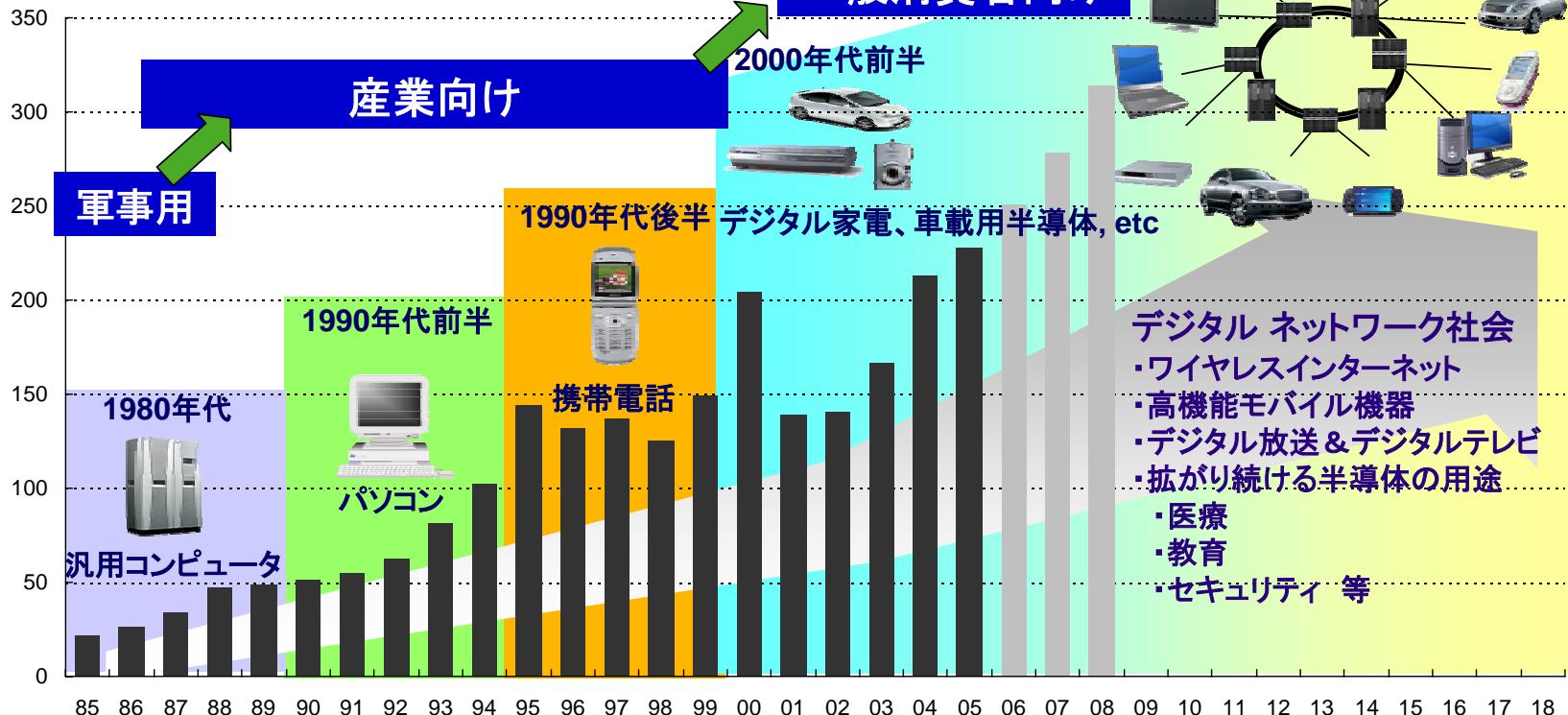
1台当たりの半導体使用量・金額の拡大

地域的な拡がり  
先進国から新経済圏、  
成長国へと世界規模で拡大



# 半導体主要用途の拡がり デジタル ネットワーク社会の到来

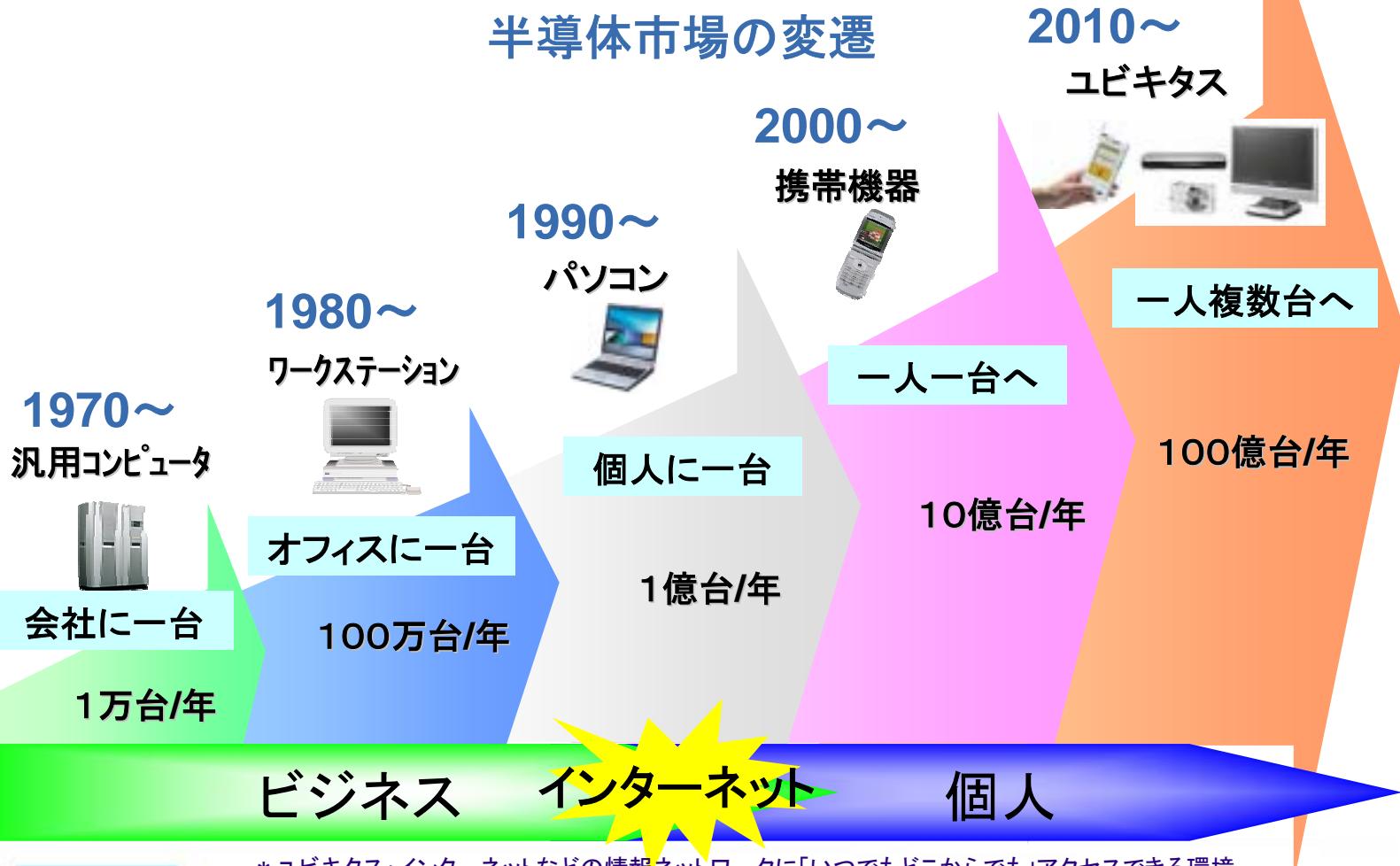
半導体市場  
(十億ドル)



出所: WSTS

# 半導体主要用途の拡がり

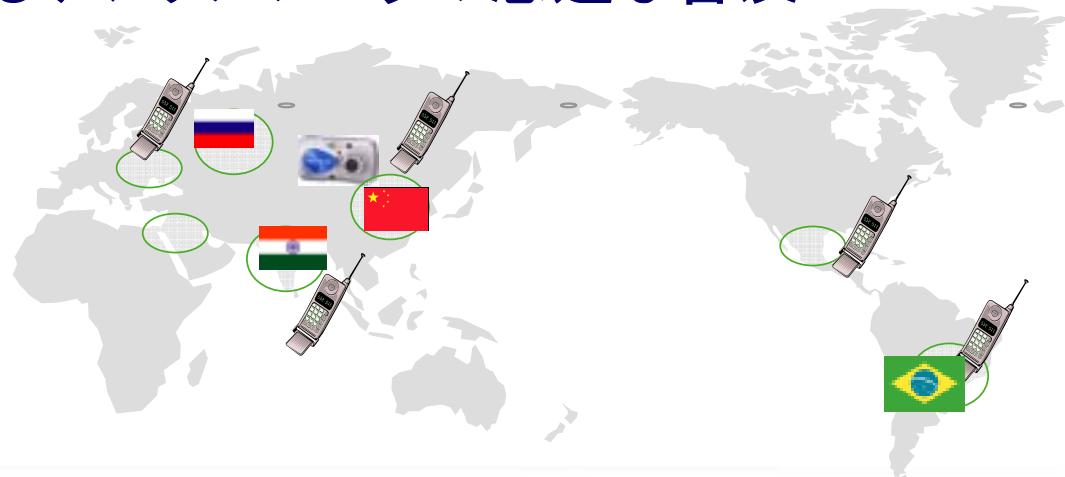
## 半導体市場の変遷



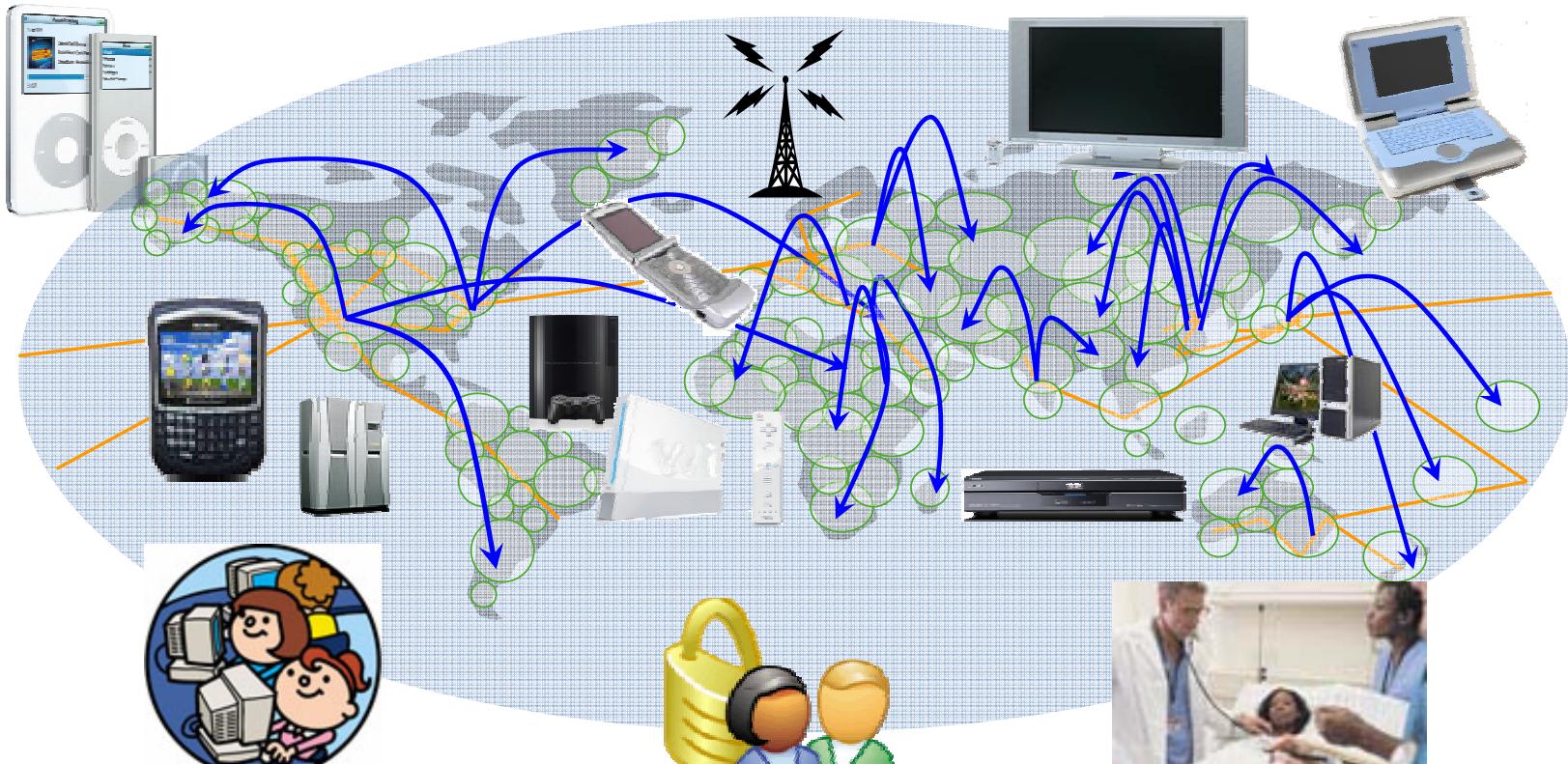
\* ユビキタス: インターネットなどの情報ネットワークに「いつでもどこからでも」アクセスできる環境。

## 地域的な拡がり

- 携帯電話の新興国での普及加速化
  - インド(2006年)7,000万台→1億5,000万台
  - 携帯電話の現地生産開始
  - 半導体前工程工場建設設計画
- 中国におけるデジタルカメラの急速な普及



# ワイヤレスで地球規模に拡がるIT産業



教育

セキュリティ

医療

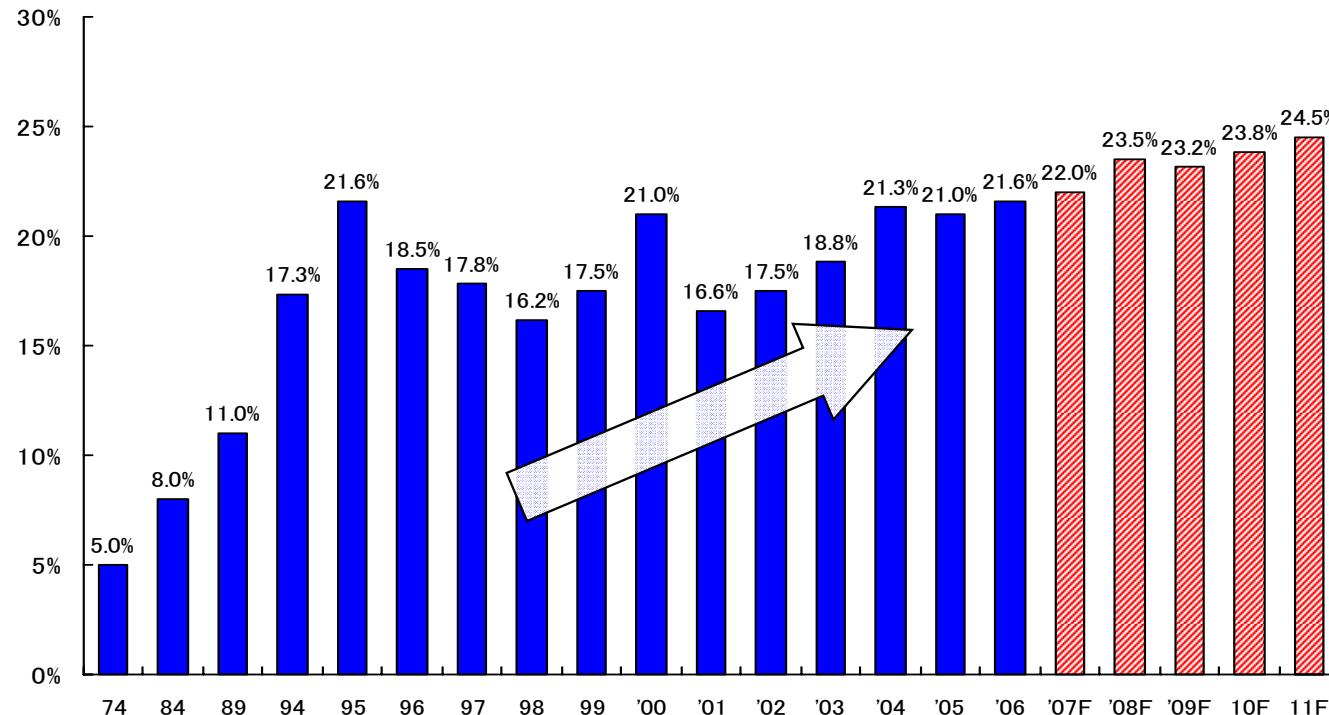
電子機器産業を越えたITネットワークの拡がり

\* IT : 情報技術



# 半導体使用量の伸び

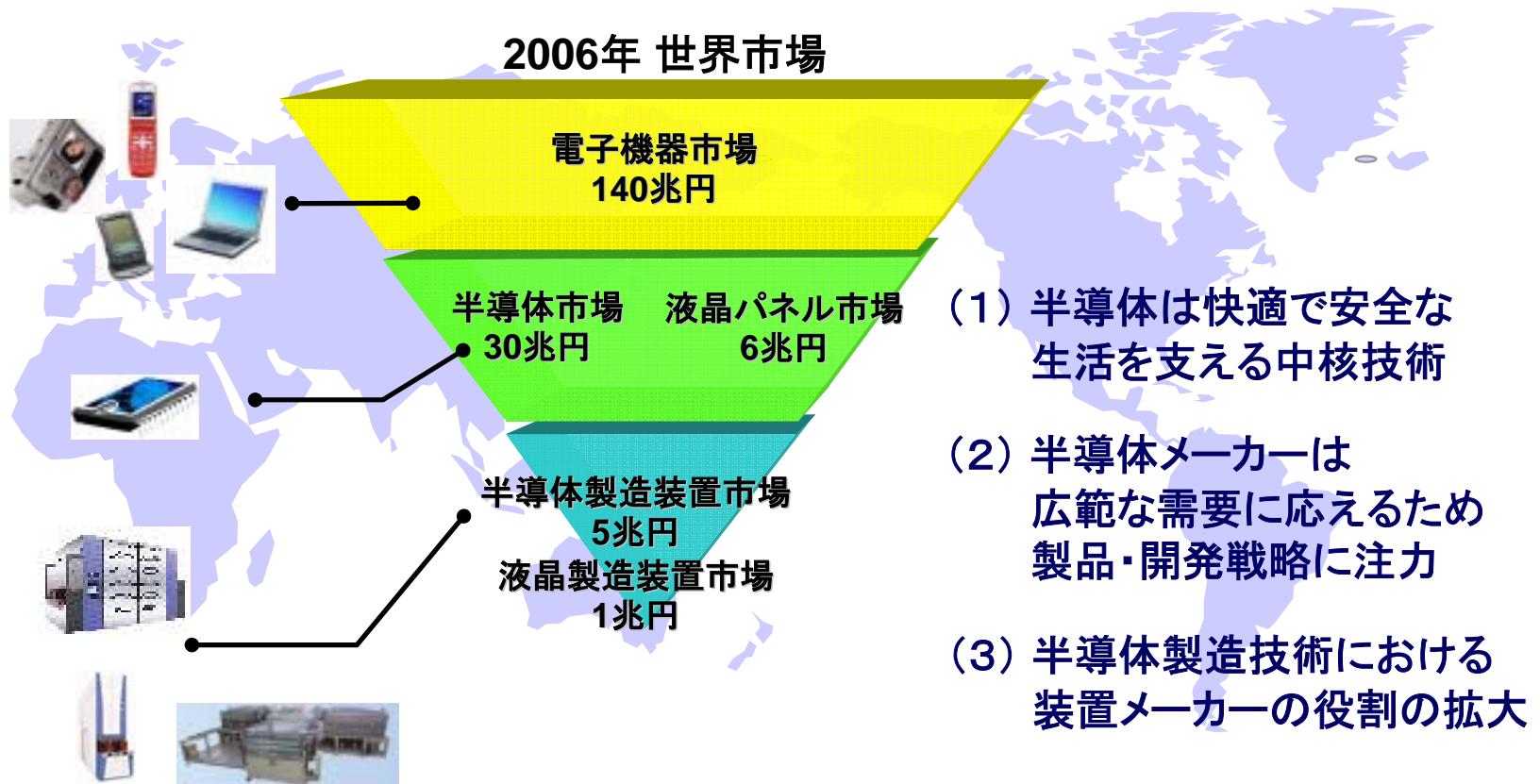
## 電子機器に占める半導体比率は上昇



半導体使用比率の推移

出典: IC Insights, '07 1月

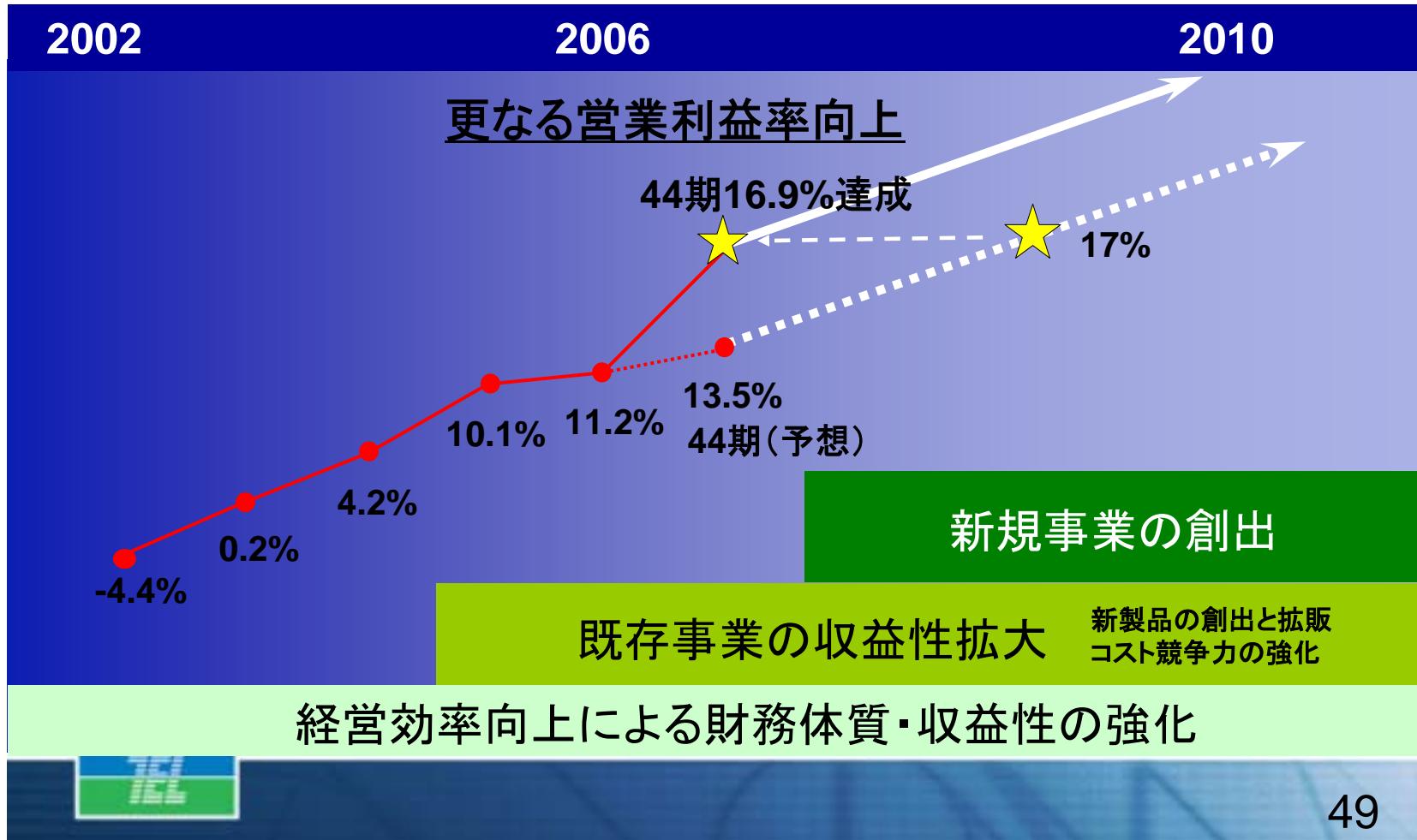
# 世界市場を支える装置産業



出所: IC Insights, WSTS, Gartner Dataquest

# 東京エレクトロンの中期成長戦略

## —中期経営計画の推進—



# 今後の経営方針

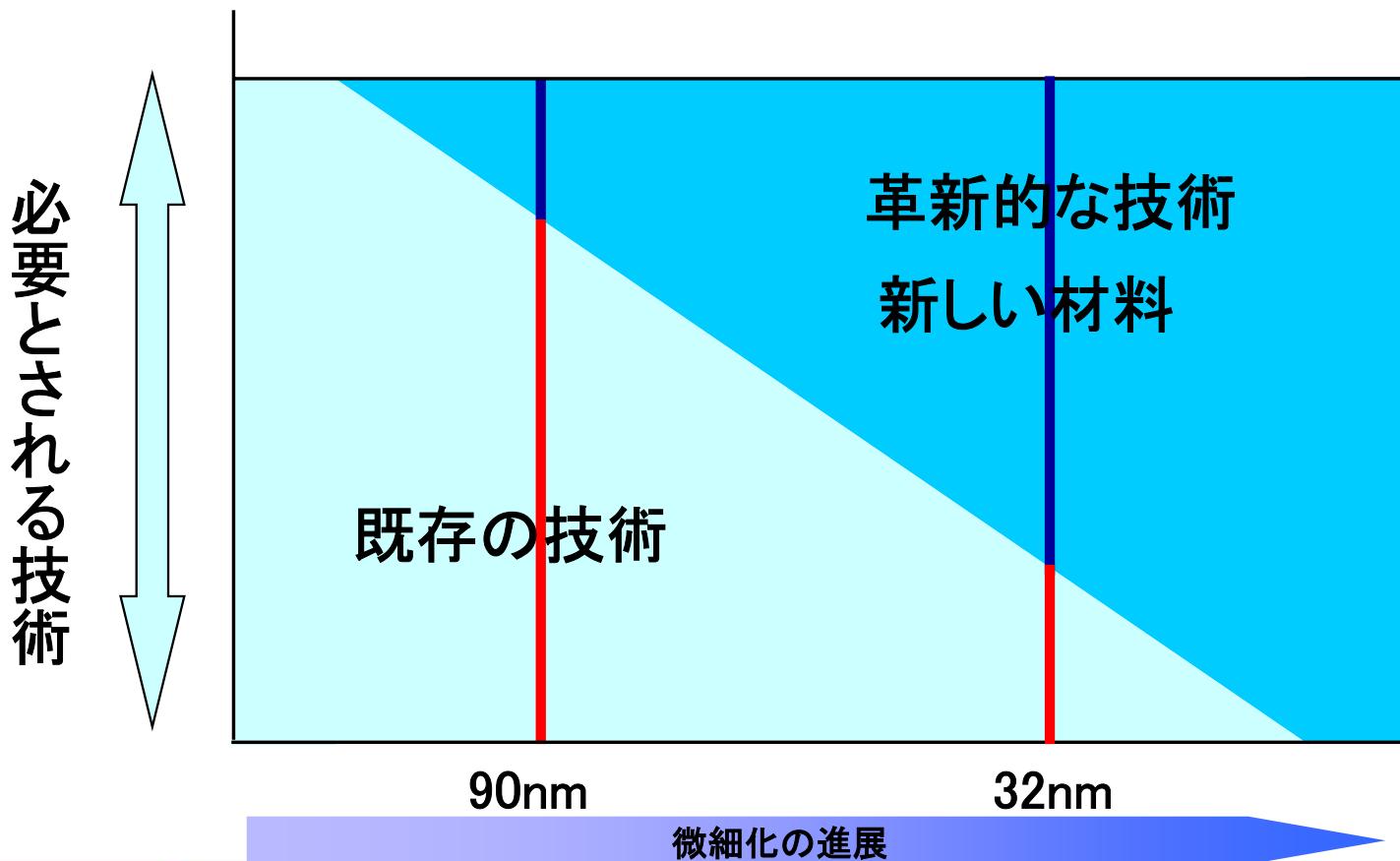


## 今後の経営方針

1. 「イノベーション(技術革新)」と「成長」
2. コーポレートガバナンスの強化
3. よき企業風土・文化を育てさらなる飛躍へ

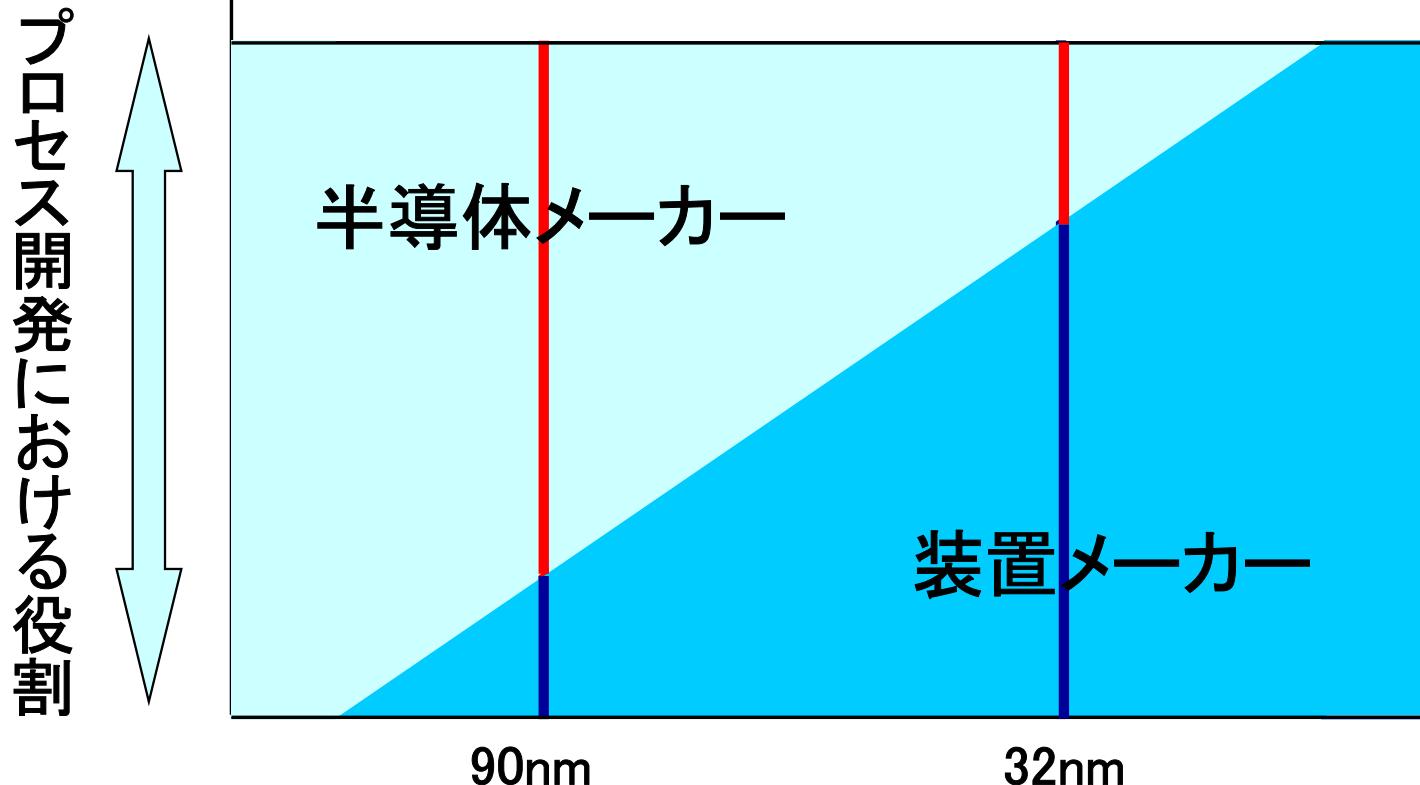


## 「イノベーション」と「成長」 新技術と既存技術が求められる割合



※1nm(ナノメートル)=1mm(ミリメートル)の百万分の1

## 「イノベーション」と「成長」 装置メーカーの役割の変化



半導体製造技術における装置メーカーの役割の増大



## 「イノベーション」と「成長」 成長戦略を実現するための重点項目



「イノベーション」



真の製造力の強化



中長期観点での利益成長



# 東京エレクトロンの中期成長戦略

## －中期経営計画の推進－

2002

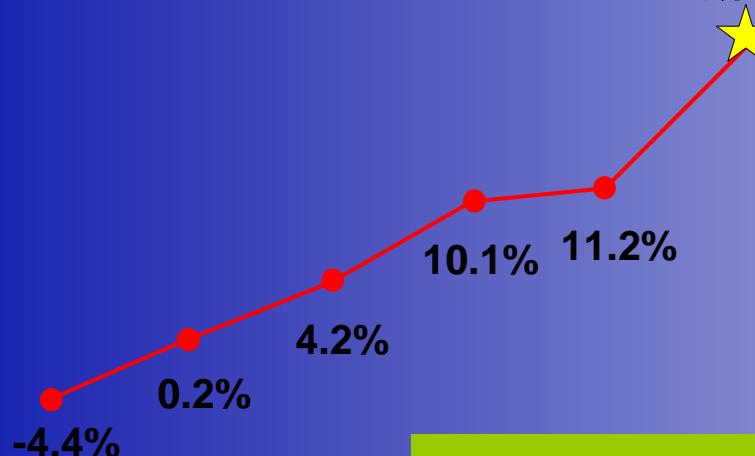
2006

目標:

売上高 1兆円 以上  
営業利益率 20% 以上

更なる営業利益率向上

44期16.9%



新規事業の創出

既存事業の収益性拡大

新製品の創出と拡販  
コスト競争力の強化

経営効率向上による財務体質・収益性の強化



## 2. コーポレートガバナンスの強化

コーポレートガバナンスとは：

企業価値の持続的成長のための経営の公正さ、透明性を確保する仕組み作り

- ステークホルダーとの利害が一致する仕組み作り
- 経営の健全性、遵法の確保
- 情報開示の充実

※ステークホルダー：企業の利害関係者のこと。株主の皆様や債権者・取引先・お客様など。



## 2. コーポレートガバナンスの強化

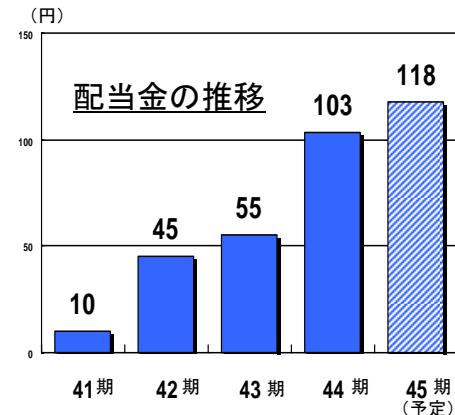
### ステークホルダーの利害を一致させた仕組み作り

#### 株主の皆様



業績向上実現を通じた株主還元の向上

(配当政策:連結配当性向 20%)



#### 取締役・執行役員への報酬



連結業績・株価との連動性を高めた報酬制度

(業績連動型報酬部分(年次賞与)=連結当期純利益の最大3%、  
現金報酬(現金賞与):株式報酬=2:1)

#### 従業員への賞与



営業利益連動型賞与制度



## 2. コーポレートガバナンスの強化

### 経営の健全性、遵法の確保

#### 企業倫理とコンプライアンス（遵法）の徹底

- ▶ 倫理基準の改訂、コンプライアンス教育の全社員への定期的実施

#### 内部統制システムの構築

- ▶ 内部統制システム基本方針制定と基本方針に基づいた実践的活動
- ▶ 日本版SOX法<sup>※1</sup>対応に向けたプロジェクトの推進

※1 金融商品取引法に定める「内部統制報告書」の提出義務及び公認会計士による監査義務



## 2. コーポレートガバナンスの強化 情報開示の充実

### 公平かつ適切な情報の開示

- ▶ 日本IR協議会よりIR優良企業賞を受賞 2006年11月
- ▶ 日本証券アナリスト協会のディスクロージャー優良企業に選定  
(精密機器部門) 2006年10月

### 経営の透明性の確保

- ▶ 報酬委員会・指名委員会の設置
- ▶ 代表取締役の報酬開示
- ▶ 取締役・執行役員の報酬制度の開示

### 3. よき企業風土・文化を育てさらなる飛躍へ



#### 東京エレクトロンが目指している会社像

- 1) 少数精銳で高収益を上げ、  
その結果社員が高収入を得られる会社
- 2) 他人のやらないことをやる会社
- 3) 風通しの良い会社
- 4) 社員がいろいろなことにチャレンジできる会社



## 夢と活力の満ちた企業に

株主の皆様をはじめとする  
世界中のステークホルダーが、  
当社と関わることによって夢を広げ  
その夢を実現できるようにしたい  
と考えています。



私たちの技術が  
世界を支え、未来を創ります。

# ＜決議事項＞

1. 取締役 13名選任の件
2. 監査役 1名選任の件
3. 第44期取締役賞与金支給の件
4. 取締役の固定報酬額改定の件
5. 当社取締役に対し 株式報酬として  
新株予約権（ストックオプション）を発行する件
6. 当社及び当社子会社の役員等に対し  
株式報酬として新株予約権（ストックオプション）を  
発行する件

# 第1号議案

取締役13名選任の件

# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
1	東 哲郎 (S24.8.28生)	<p>昭和52年 4月 当社入社</p> <p>平成 2年12月 当社取締役</p> <p>平成 6年 4月 当社常務取締役</p> <p>平成 8年 6月 当社取締役社長</p> <p>平成15年 6月 当社取締役会長 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 代表取締役会長</p> <p>(他の法人等の代表状況) Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長 (社)日本半導体製造装置協会会长</p>	29,028株



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
2	常石 哲男 (S27.11.24生)	<p>昭和51年 4月 当社入社</p> <p>平成 4年 6月 当社取締役</p> <p>平成 8年 6月 当社専務取締役</p> <p>平成15年 6月 当社取締役副会長 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役副会長 IR、法務・知的財産、 カスタマーリレーション担当</p> <p>(他の法人等の代表状況) Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. 取締役会長 Tokyo Electron (Shanghai) Logistic Center Ltd. 取締役会長</p>	3,658株



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
3	佐藤 潔 (S31.4.2生)	<p>昭和54年 4月 当社入社</p> <p>平成13年12月 当社クリートラックBUGM</p> <p>平成15年 4月 当社社長付執行役員</p> <p>平成15年 6月 当社取締役社長 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 代表取締役社長</p> <p>(他の法人等の代表状況)</p> <p>Tokyo Electron America, Inc.取締役 最高経営責任者</p> <p>Timbre Technologies, Inc.取締役会長</p> <p>TEL Venture Capital, Inc.取締役会長</p> <p>Tokyo Electron Europe Ltd.取締役会長</p> <p>Tokyo Electron Korea Solution Ltd. 取締役会長</p>	2,000株

※BUGM=ビジネスユニットシェネラルマネージャー



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
4	岩津 春生 (S25.3.20生)	<p>昭和59年11月 当社入社</p> <p>平成 5年 4月 東京エレクトロン九州(株) 取締役</p> <p>平成10年 4月 同社常務取締役</p> <p>平成12年 1月 当社洗浄システムBUGM</p> <p>平成15年 4月 東京エレクトロン九州(株) 取締役社長</p> <p>平成17年 6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>平成18年10月 東京エレクトロン九州(株) 取締役会長 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 常務執行役員 製造・IT部門統轄</p>	1,000株

※BUGM=ビジネスユニットジェネラルマネージャー



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
5	原 護 (S21.8.14生)	<p>昭和45年 4月 当社入社</p> <p>平成元年12月 当社取締役</p> <p>平成 8年 4月 東京エレクトロン東北(株) 専務取締役</p> <p>平成 8年 6月 当社取締役退任</p> <p>平成11年 3月 東京エレクトロンEE(株) 取締役社長</p> <p>平成13年 7月 東京エレクトロンテ'バイス(株) 取締役会長</p> <p>平成14年 2月 東京エレクトロンAT(株) 取締役社長</p> <p>平成14年 6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役</p>	6,000株

# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
6	久保寺 正男 (S24.6.21生)	<p>昭和54年 1月 当社入社</p> <p>平成 6年 4月 テル・エンジニアリング(株)取締役</p> <p>平成 7年 7月 東京エレクトロン山梨(株) 常務取締役</p> <p>平成10年 4月 東京エレクトロン宮城(株) 取締役社長</p> <p>平成13年 4月 東京エレクトロンAT(株) 専務取締役</p> <p>平成15年 4月 同社取締役会長</p> <p>平成16年 6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 常務執行役員 技術・開発部門統轄</p> <p>(他の法人等の代表状況) Tokyo Electron Arizona, LLC 取締役会長 TEL Technology Center, America, LLC取締役会長</p>	2,552株

# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
7	<b>本田 祐一</b> (S22.8.22生)	<p>昭和61年 7月 当社入社</p> <p>平成 6年 6月 当社取締役</p> <p>平成10年 4月 当社コーポレート・シニア・スタッフ</p> <p>平成10年 6月 当社取締役退任</p> <p>平成14年 3月 Tokyo Electron Europe Ltd. 取締役</p> <p>平成17年 6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 常務執行役員 財務・経理担当</p>	5,100株



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
8	北山 博文 (S29.3.28生)	<p>昭和58年12月 テル・サーモコ(株)入社</p> <p>平成 7年 7月 東京エレクトロン東北(株)取締役</p> <p>平成11年 3月 東京エレクトロン山梨(株)取締役</p> <p>平成15年 4月 東京エレクトロンAT(株) 常務執行役員</p> <p>平成17年 2月 同社取締役社長</p> <p>平成18年 4月 東京エレクトロン東北(株) 取締役社長 (現在に至る)</p> <p>当社執行役員、SPE-3事業部長 (現在に至る)</p> <p>(他の法人等の代表状況) 東京エレクトロン東北(株)取締役社長</p>	0株



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数	
9	竹中博司 (S36.2.5生)	昭和59年 4月 平成13年12月 平成14年 4月  平成17年 4月  平成18年 4月	当社入社 当社枚葉成膜部長 当社執行役員 (現在に至る) 当社枚葉成膜BUGM 当社サーマルプロセス システムBUGM (現在に至る) 当社SPE-3事業部 副事業部長 (現在に至る)	100株

※BUGM=ビジネスユニットジェネラルマネージャー



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
10	鷺野 憲治 (S36.6.7生)	<p>昭和59年 4月 当社入社</p> <p>平成14年10月 当社洗浄システム部長</p> <p>平成15年 4月 当社執行役員 (現在に至る)</p> <p>当社洗浄システムBUGM</p> <p>平成17年 4月 当社枚葉成膜BUGM (現在に至る)</p> <p>平成18年 4月 当社SPE-2事業部 副事業部長 (現在に至る)</p>	2,000株

※BUGM=ビジネスユニットジェネラルマネージャー



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)		所有する当社の株式数
11	伊東 晃 (S36.8.30生)	昭和59年 4月 平成13年 6月 平成15年 4月 平成18年 4月	当社入社 Tokyo Electron America, Inc.クリートラックBUマネージャー 当社執行役員 クリートラックBUGM (現在に至る) 当社SPE-1事業部 副事業部長 (現在に至る)	0株

※BU=ビジネスユニット

※BUGM=ビジネスユニットジェネラルマネージャー



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
12	井上 弘 (S15.1.5生)	<p>昭和38年 4月 (株)東京放送入社</p> <p>平成 5年 6月 同社取締役</p> <p>平成 8年 6月 同社常務取締役</p> <p>平成 9年 6月 同社専務取締役</p> <p>平成13年 6月 同社取締役副社長</p> <p>平成14年 6月 同社取締役社長 (現在に至る)</p> <p>平成18年 6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役</p> <p>(他の法人等の代表状況) (株)東京放送取締役社長 (株)TBSテレビ取締役社長</p>	0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります



# 第1号議案

第44期定時株主総会

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
13	常深 康裕 (S24.1.21生)	昭和48年 4月 (株)日立製作所入社 平成10年 2月 (株)日立総合計画研究所 (出向)主管研究員 平成18年 2月 (株)日立製作所退社 平成18年 6月 当社取締役 (現在に至る)  (当社における地位及び担当) 取締役	0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります



## 第2号議案

監査役1名選任の件

## 第2号議案

第44期定時株主総会

氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
吉田 光孝 (S23.3.31生)	<p>昭和55年 2月 当社入社</p> <p>平成 2年 3月 東京エレクトロン相模(株)取締役</p> <p>平成 3年 4月 同社常務取締役</p> <p>平成 5年 4月 東京エレクトロン東北(株)専務取締役</p> <p>平成 7年 4月 同社取締役社長</p> <p>平成 8年 6月 当社取締役</p> <p>平成10年 6月 当社常務取締役</p> <p>平成14年 2月 当社取締役</p> <p>平成15年 4月 東京エレクトロン ソフトウェア・テクノロジーズ(株) 取締役社長</p> <p>平成15年 6月 当社取締役退任</p> <p>平成19年6月20日 東京エレクトロン ソフトウェア・テクノロジーズ(株) 取締役退任</p>	10,500株



# ＜決議事項＞

1. 取締役13名選任の件
2. 監査役1名選任の件
3. 第44期取締役賞与金支給の件
4. 取締役の固定報酬額改定の件
5. 当社取締役に対し株式報酬として新株予約権（ストックオプション）を発行する件
6. 当社及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として新株予約権（ストックオプション）を発行する件

# < 役員報酬体系 >

## 取締役報酬

固定的報酬（月額報酬）

業績連動報酬  
(年次賞与)

## 監査役報酬

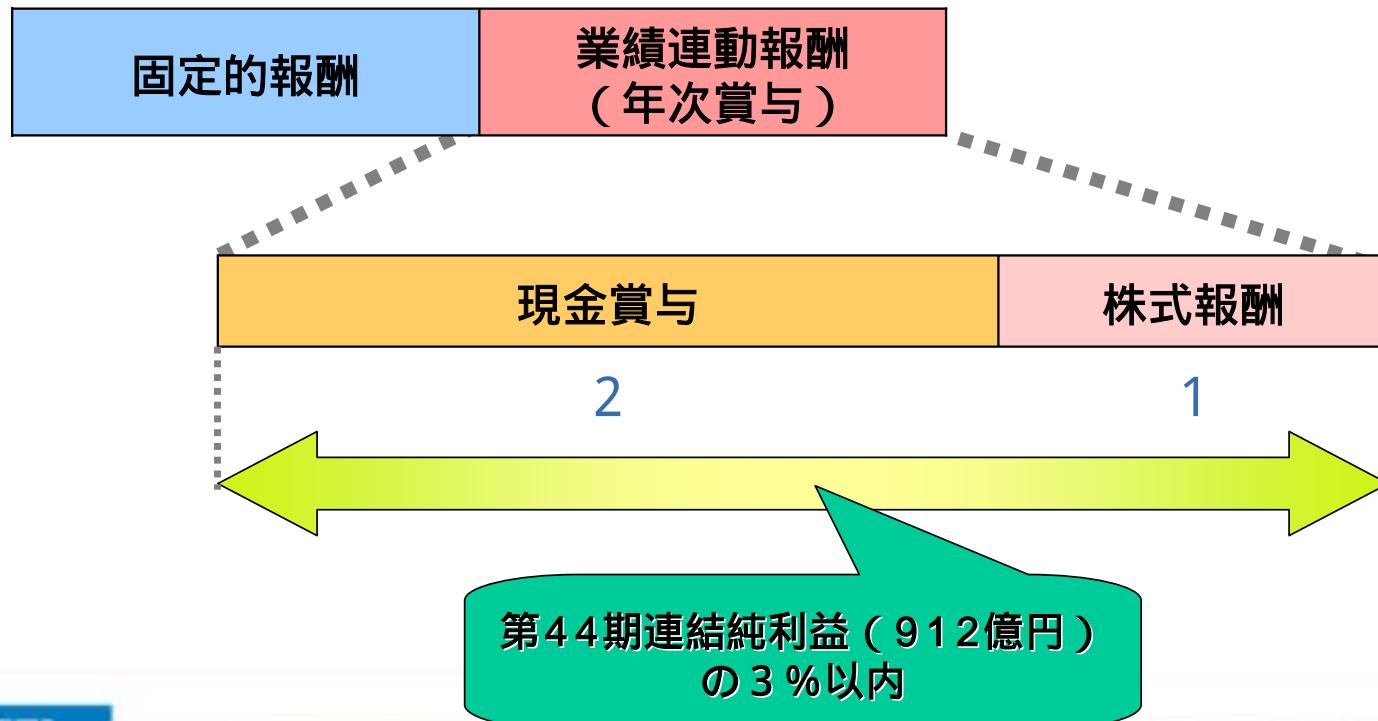
固定的報酬（月額報酬）

役員退職慰労金 第43期以降、廃止しております



# < 業績連動報酬（年次賞与）>

対象者：当社グループの取締役、執行役員



# < 業績連動報酬（年次賞与）>

## 第44期業績連動報酬と議案の関係

	現金賞与	株式報酬
当社取締役	<第3号議案>	<第5号議案>
当社執行役員、 グループ会社の 取締役・執行役員	代表取締役が 配分を決定	<第6号議案>
合計	第44期連結純利益（912億円）の 3%（27億円）以内	



## 第3号議案

第44期取締役賞与金支給の件

## ◆第44期連結純利益(912億円)に対応する業績連動報酬 (年次賞与)の現金報酬分

第44期取締役賞与金	
対象者	第44期末時点在籍の取締役11名 (うち社外取締役2名)
報酬額	総額 3億9, 600万円 (うち社外取締役分 1, 000万円)

## 第4号議案

取締役の固定報酬額改定の件

	現 行	改 定 案
固定報酬枠	<p>年額 4億2,000万円以内 (月額 3,500万円以内)</p> <p>～平成17年6月改定～</p>	<p>1事業年度につき 5億6,000万円以内※1</p> <p>(うち社外取締役分 1事業年度 2,000万円以内)</p>

※1 執行役員兼務取締役の執行役員分給与を含む



## 第5号議案

当社取締役に対し株式報酬として  
新株予約権(ストックオプション)を  
発行する件



## 株式報酬枠

### ◆第44期連結純利益(912億円)に対応する業績連動報酬 (年次賞与)の株式報酬分

取締役に対する株式報酬枠	
対象者	当社取締役(社外取締役を除く) ※第1号議案が原案どおり承認可決された場合、対象者は 11名となります
報酬総額	年額 2億8,000万円以内



## 新株予約権の内容①

株主以外の者に対し、特に有利な条件で新株予約権を発行する理由

第44期連結当期純利益(912億円)に対応する業績連動報酬(年次賞与)の株式報酬分。

割当対象者

当社取締役(社外取締役を除く)

## 新株予約権の内容②

目的となる株式	当社普通株式 40,000株(上限)
新株予約権の数	400個(上限) (新株予約権1個につき、100株)
発行の際の払込金額 (発行価額)	無償
行使価額	1株当たり、1円
権利行使期間	①始期：新株予約権の割当日から3年を経過する日 ②終期：取締役会で決定(割当日から最長20年の範囲内)
行使条件	①最低行使単位＝新株予約権1個(100株) ②その他の権利行使の条件 新株予約権発行の取締役会決議、及び同決議に基づき 締結される新株予約権割当契約による



## 第6号議案

当社及び当社子会社の役員等に対し  
株式報酬として  
新株予約権(ストックオプション)を  
発行する件

## 新株予約権の内容①

### 株主以外の者に対し、特に有利な条件で新株予約権を発行する理由

1. 第44期連結当期純利益(912億円)に対応する業績連動報酬(年次賞与)の株式報酬分
2. 優秀な人材確保の競争力維持を目的とした株式報酬型ストックオプション

### 割当対象者

#### 第44期期末時点の

1. 当社の執行役員(割当日時点の当社取締役を除く)  
本総会終結をもって退任となる当社取締役  
当社国内子会社の取締役・執行役員  
当社海外子会社の会長・社長・副社長
2. 当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)・上級幹部従業員



## 新株予約権の内容②

目的となる株式	当社普通株式 90,000株(上限)
新株予約権の数	900個(上限) (新株予約権1個につき、100株)
発行の際の払込金額 (発行価額)	無償
行使価額	1株当たり、1円
権利行使期間	①始期：新株予約権の割当日から3年を経過する日 ②終期：取締役会で決定(割当日から最長20年の範囲内)
行使条件	①最低行使単位＝新株予約権1個(100株) ②その他の権利行使の条件 新株予約権発行の取締役会決議、及び同決議に基づき 締結される新株予約権割当契約による





私たちの技術が  
世界を支え、未来を創ります。